



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**  
**DIRECCIÓN DE POSGRADO**  
**FORMATO GUÍA PARA REGISTRO DE ASIGNATURAS**

Hoja 1 de 3

### I. DATOS DEL PROGRAMA Y LA ASIGNATURA

- 1.1 NOMBRE DEL PROGRAMA: MAESTRÍA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL.
- 1.2 COORDINADOR DEL PROGRAMA: M. en C. ISIDRO MARCO ANTONIO CRISTÓBAL VÁZQUEZ
- 1.3 NOMBRE DE LA ASIGNATURA: ESTADÍSTICA APLICADA
- 1.4 CLAVE: 10B6202 (Para ser llenado por la SIP)
- 1.5 TIPO DE ASIGNATURA: OBLIGATORIA  OPTATIVA   
 SEMINARIO  ESTANCIA
- 1.6 NÚMERO DE HORAS: 51 TEORÍA  51 PRACTICA  T-P
- 1.7 UNIDADES DE CRÉDITO:  6
- 1.8 FECHA DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: 

16	08	2010
d	m	a
- 1.9 SESIÓN DEL COLEGIO DE PROFESORES EN QUE SE ACORDÓ LA IMPLANTACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

SESIÓN No.	Ord. 10- 10
------------	-------------------

FECHA:	19	10	2010
	d	m	a
- 1.10 FECHA DE REGISTRO EN SIP: 

d	M	a

 (Para ser llenado por la SIP)

### II. DATOS DEL PERSONAL ACADÉMICO

- 2.1 COORD. ASIGNATURA: FAUSTINO RICARDO GARCÍA SOSA CLAVE: 5695-EC-08
- 2.2 PROFR. PARTICIPANTE: JUAN CARLOS GUTIÉRREZ MATUS CLAVE: 6836-EC-10  
 CLAVE: \_\_\_\_\_



### III.3 BIBLIOGRAFIA UTILIZADA EN LA ASIGNATURA

1. RICHARD L. SCHEAFFER, WILLIAM MENDENHALL, LYMAN OTT. ELEMENTOS DE MUESTREO. GRUPO EDITORIAL IBEROAMÉRICA.

2. SHARON L. LOHR. MUESTREO DISEÑO Y ANÁLISIS, 2000. THOMSON EDITORES.

3. EDUARDO GUTIERREZ. FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL PARA INGENIERÍA Y CIENCIAS. NAUKA-EDUCACIÓN.

4. VICENTE C. ALONSO. CONTROL ESTADISTICO DE LA CALIDAD. ALFAOMEGA.

5. DOUGLAS C. MONTGOMERY Y GEORGE C. RUNGER. PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA APLICADAS A LA INGENIERÍA. MCGRAW-HILL.

6. HUMBERTO GUTIÉRREZ PULIDO. ANÁLISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS. MCGRAW-HILL. SEGUNDA EDICIÓN.

7. DOUGLAS C. MONTGOMERY. DESIGN AND ANALYSIS OF EXPERIMENTS. TERCERA EDICIÓN. JOHN WILEY & SONS, NEW YORK.

8. MINITAB STATISTICAL SOFTWARE. MINITAB INC. STATE COLLAGE, PA, USA.

9. SOFTWARE EXCEL.

### III.4 PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN A UTILIZAR

APLICACIÓN DE EXÁMENES 50%

EXPOSICIÓN 20%

TRABAJO FINAL 30%